



(19) Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 1 186 681 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
13.03.2002 Patentblatt 2002/11

(51) Int Cl.7: C23C 14/32, H01J 37/32,
C23C 14/50, C23C 14/34

(21) Anmeldenummer: 01119423.0

(22) Anmeldetag: 11.08.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 05.09.2000 CH 17272000

(71) Anmelder: Unaxis Balzers Aktiengesellschaft
9496 Balzers (LI)

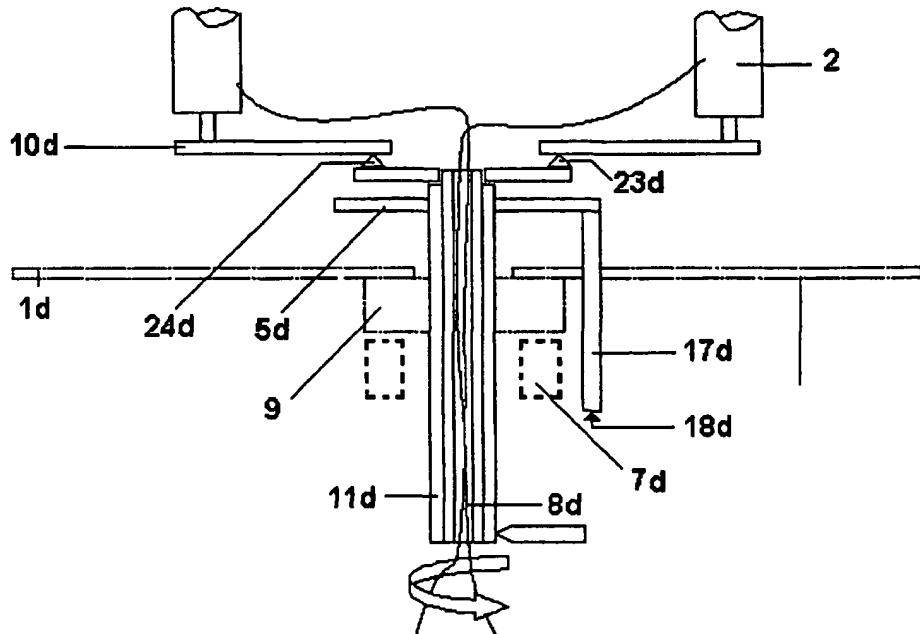
(72) Erfinder:
• Seeli, Roger
CH-9477 Truebbach (CH)
• Pedrazzini, Mauro
FL-9492 Eschen (LI)
• Derflinger, Volker
A-6800 Feldkirch (AT)

(54) Vakuumanlage mit koppelbarem Werkstückträger

(57) Eine Vakuumanlage zum Behandeln von Werkstücken weist eine evakuierbare Behandlungskammer mit einer zentral angeordneten Niedervoltbogen-Entladungsanordnung und seitlich angeordneter Ladeöffnung auf. Eine Kopplungsvorrichtung zwischen Werk-

stückträger (10d) und einer anlagenseitigen Aufnahmeverrichtung erlaubt das vereinfachte Be- und Entnehmen der zu behandelnden Werkstücke (2) mitsamt dem Träger durch einfaches Anheben resp. Absetzen auf/ von der Aufnahmeverrichtung.

Fig.4



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuumanlage zum Behandeln von Werkstücken, mit einer evakuierbaren Behandlungskammer, in deren Zentralachse eine Niedervoltbogen-Entladungsanordnung angeordnet ist, und mindestens einer an einer Seitenwand der Behandlungskammer angebrachten Beschichtungsquelle sowie einem Werkstückträger, auf dem Werkstücke gegebenenfalls auf zusätzlichen Werkstückhaltern montiert sind.

[0002] Im Stand der Technik ist es für verschiedene Vakuumbehandlungsprozesse bekannt, vor und/oder nach der Vakumbeschichtung Reinigungs- und/oder Heizschritte vorzunehmen. Solche Schritte sind vor allem notwendig, um einer abzuscheidenden Schicht eine gute Haftfestigkeit zu verleihen. Besonders wichtig ist dies bei Anwendungen, wo Werkstücke, insbesondere Werkzeuge und mechanisch hochbelastete Bauteile, mit einer verschleissfesten Hartstoffsicht beschichtet werden sollen. Solche Schichten sind bei Werkzeugen, wie beispielsweise bei Bohrern, Fräsern und Umformwerkzeugen bzw. Bauteilen wie Zahnrädern, Nadeln für Einspritzdüsen, Tassenstösseln, Nockenwellen sowie andere schnell bewegte oder stark belastete Teile besonders hohen mechanischen und abrasiven Beanspruchungen ausgesetzt. Eine extrem gute Haftung mit der Unterlage ist deshalb Voraussetzung für einen brauchbaren und wirtschaftlichen Einsatz. Eine bewährte Methode solche Werkstücke vorzubehandeln ist einerseits das Heizen, insbesondere mit Elektronenbeschuss und andererseits das Ätzen mittels Ionenätzten beziehungsweise Zerstäubungsätzten. Das Beheizen mittels Elektronenbeschuss aus einer Plasmaentladung ist beispielsweise bekannt geworden aus der DE 33 30 144. Eine Plasmaentladungsstrecke kann auch verwendet werden, um schwere Edelgasionen zu erzeugen, beispielsweise Argonionen, welche aus diesem Plasma auf das Werkstück beziehungsweise das Substrat beschleunigt werden, um dort ein Zerstäubungsätzen zu bewirken, wie dies in der DE 28 33 876 beschrieben ist. Neben dem Zerstäubungsätzen ist es auch bekannt geworden, Plasmaentladungen mit zusätzlichen Reaktivgasen zu betreiben und die Werkstücke reaktivchemisch zu ätzen, wobei auch Mischformen zwischen diesem Reaktivätzen und dem Zerstäubungsätzen möglich sind. Unterstützend wird häufig bei den vorbeschriebenen Verfahren die Behandlungskammer mit einer Elektromagnet-Spulenanordnung umgeben, vorzugsweise nach Art von Helmholtz-Spulenpaaren, die es erlaubt, das Plasma zusätzlich zu beeinflussen, z. B. zur Erhöhung der Plasmadichte bzw. zur Konzentration des Plasmaeinschlusses, was einen stärkeren Ionenbeschuss bewirkt oder zur Steuerung der Plasmaverteilung in der Anlage beispielsweise durch Änderung der Spulenströme während der Plasmabehandlung und Ähnliches.

[0003] Bei all diesen Vorbehandlungsverfahren geht

es darum, die Werkstücksoberfläche so vorzubereiten, dass die nachfolgende Beschichtung gut auf der Unterlage haftet. Zur Plasmaerzeugung wird bei den vorerwähnten Anordnungen eine Niedervoltbogenentladung

5 verwendet, welche in der Zentralachse der Anlage angeordnet ist, wobei die Werkstücke in einem bestimmten Abstand um diesen Bogen herum und entlang einer Zylinderfläche angeordnet sind. Die Beschichtung erfolgt anschliessend mittels thermischem Aufdampfen oder Katoden-Zerstäuben oder Mischformen wie Arc-Verdampfen. Je nach Prozessführung wird hierbei durch entsprechenden Substratbias während der Beschichtung ein zusätzlicher Ionenbeschuss erzeugt, welches unter dem Begriff Ionenplattieren (ion plating) bekannt geworden ist.

[0004] Diese Anordnung hat den Vorteil, dass aus der Niedervoltbogenentladung grosse Ionenströme bei niedriger Teilchenenergie gezogen werden können und somit das Werkstück schonend behandelt werden kann.

20 Durch die bei physikalischen Verfahren notwendige bewegliche Anordnung der zu beschichtenden Teile um eine zentral in der Anlage angebrachte Vorrichtung zur Zündung eines Niedervoltbogens ergibt sich ein relativ komplizierter mechanischer Aufbau. So werden die zu beschichtenden Teile heute oft auf einzelnen rotations-symmetrisch um die Anlagenachse angeordneten, oder ihrerseits wieder auf bevorzugt karussellähnlichen Werkstückträgern drehbeweglich montierten, Werkstückhaltern befestigt. Weiters sind zur Durchführung

25 der verschiedenen Prozessschritte unterschiedliche elektrische Potentiale an die zentral angeordnete Anode und die einzelnen Werkstückhalter bzw. den Werkstückträger anzulegen und diese gegenseitig und zusätzlich gegen die auf Masse gelegte Anlage elektrisch zu isolieren. Bei Bedarf sind für Temperatursensoren oder andere Messeinrichtungen noch weitere elektrische Durchführungen vorzusehen. Aufgrund der oben beschriebenen komplexen mechanischen und elektrischen Voraussetzungen wurden bei industriellen Anlagen zur gleichzeitigen Beschichtung einer grossen Anzahl oder einzelner entsprechend schwerer Teile, die

30 Werkstückhalter bzw. karussellähnlichen Werkstückträger zwar drehbeweglich, aber nicht auf einfache Weise lösbar mit der Anlage bzw. dem Anlagenboden verbunden. Ein Be- und Entladen durch eine seitliche Öffnung ist dann jedoch, zudem noch aufgrund der zentralen Einbaulage der Niedervoltbogen-Entladungsanordnung, schwierig. Daher wurde im grossindustriellen Einsatz eine Anordnung gewählt, mit der es möglich ist, hydraulisch oder mit Spindelantrieben den Anlagenboden

35 inclusive des darauf montierten Werkstückträgers abzusenken. Eine weitere denkbare Variante besteht darin, den Rezipienten nach oben abzuheben. Beiden gemeinsam ist die nachteilige Notwendigkeit, alle Versorgungsleitungen (z. B. Kühlwasser und Elektrik) für den als Ladeöffnung ausgebildeten Anlageboden bzw. Rezipienten in aufwendiger beweglicher Ausführung vorzusehen. Die notwendige Bauhöhe und die längeren

Standzeiten solcher Anlagen bei Be- und Entladung sind darüberhinaus unwirtschaftlich.

[0005] Um diesen Nachteilen zu begegnen wurde in US 5,709,784 eine Anlage offenbart, die besonders für die grossindustrielle Massenfertigung geeignet ist. Dabei konnte erstmals für PVD-Anlagen mit Niedervoltbogen-Entladungsanordnung dieser Größenordnung (Beschichtungsbreite bis zu 1000mm und mehr) eine einfache Front-Be- und Entladung vorgesehen werden. Die mindestens eine Niedervoltbogen-Entladungsanordnung wurde dazu seitlich an den Rezipienten, mit ihrer linearen Ausdehnung parallel zu einem beweglichen Werkstückträger angebracht. Dem Handlungsvorteil der asymmetrischen Anordnung ausserhalb des zentralen Beschichtungsraums stehen im Vergleich zu einer zentralen Anordnung der Niedervoltbogen-Entladungsanordnung aber geometrisch bedingte Einschränkungen gegenüber.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demnach, die aufgeführten Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden, darüberhinaus kurze Behandlungszeiten von Werkstücken in einer Vakuumbehandlungsanlage zu erlauben, insbesondere kürzere Stillstandzeiten der Anlage, einfachere Bauweise und grösere Wirtschaftlichkeit.

[0007] Erreicht wird dies dadurch, dass der Werkstückträger durch eine kraft- und medienschlüssige Kopplungseinrichtung lösbar mit einer Aufnahmeverrichtung im Boden der Behandlungskammer verbunden ist und die Beschichtungskammer eine seitlich, bevorzugt auf der Vorderseite, angebrachte verschliessbare Öffnung aufweist, deren Querschnitt grösser als der des Werkstückträgers ist, so dass der Werkstückträger gemeinsam mit den gegebenenfalls auf zusätzlichen Werkstückhaltern montierten Werkstücken entkoppelt und aus der Vakuumanlage entfernt werden kann.

[0008] Der Einsatz der zentralen Niedervoltbogen-Entladungsanlage erlaubt ein Ätzen bzw. ionenunterstütztes Beschichten aus der Zentralachse der Behandlungskammer mit allen Vorteilen einer symmetrischen Anordnung einer solchen Entladungsanlage. Zudem werden Vorteile durch die Symmetrie einer möglichen magnetischen Plasmafokussierung erzielt. Die lösbare Kopplung von Werkstückträger und Aufnahmeverrichtung erlaubt ein schnelles Be- und Entladen des Werkstückträgers, vor allem durch die bevorzugte seitliche Öffnung in der Behandlungskammer.

[0009] In einer Ausführungsform sind am Werkstückträger kraftschlüssige Führungs- und Verbindungseinrichtungen vorgesehen, die mit entsprechenden Gegenstücken der Aufnahmeverrichtung der Vakuumanlage korrespondieren. Beim Entladen wird durch das Anheben des Werkstückträgers in der Vakuumanlage, z. B. mit einer geeigneten Hubvorrichtung, die Kopplung gelöst. Umgekehrt wird beim Beladevorgang durch das Absetzen des Werkstückträgers auf die Aufnahmeverrichtung in der Behandlungskammer eine kraft- und medienschlüssige Verbindung erreicht. In einer bevorzug-

ten Ausführungsform werden die Führungs- und Verbindungseinrichtung der lösbarer Kopplung mit Führungsstiften, bevorzugt selbstzentrierenden Dornen, realisiert, die in entsprechende Vertiefungen, bevorzugt

5 Bohrungen in der Aufnahmeverrichtung, eingreifen. In weiteren Varianten ist es möglich, die Dorne am Werkstückträger oder an der Aufnahmeverrichtung anzubringen oder eine Kombination von beidem. Weiterhin lässt sich durch eine asymmetrische Anordnung der Führungsstifte eine eindeutige Lagezuordnung Werkstückträger - Aufnahmeverrichtung erreichen.

[0010] Der Werkstückträger ist gemäss einer Ausführungsform der Erfindung rotierbar um die Zentralachse der Behandlungskammer ausgeführt. Die Erfindung lässt den Einsatz weiterer, dem Stand der Technik entsprechenden Ausführungen von Werkstückträgern, gegebenenfalls mit zusätzlichen Werkstückhaltern, die dem jeweiligen Einsatzzweck entsprechen, zu.

[0011] Für den Einsatz in einer Vakumbeschichtungsanlage weiterhin vorteilhaft ist die drehbare Ausführung der Aufnahmeverrichtung für den Werkzeugträger in der Zentralachse der Behandlungskammer. Zusammen mit einem weiteren vorteilhaften Merkmal, einem motorischen Antrieb, ist es möglich, die zu behandelnden Werkstücke, gegebenenfalls auf zusätzlichen Werkstückhaltern, die wiederum als Karussell auf den Werkstückträgern ausgeführt sein können, an den Beschichtungs/Ätzquellen vorbeizubewegen, um eine gleichmässige Behandlung zu ermöglichen.

[0012] Wird die Aufnahmeverrichtung im wesentlichen als eine lotrechte Hohlachse ausgebildet, an deren oberem Ende, im Rezipienten, die Aufnahmeverrichtung angebracht ist, und deren unteres Achsenende im Atmosphärenbereich liegt, so kann mittels bekannter Vorrichtungen eine vakuumdichte Drehdurchführung realisiert werden. Vorteilhaft kann so der motorische Antrieb wartungsfreundlich zugänglich ausserhalb angebracht werden und durch die Hohlachse Mess-, Steuer- und Versorgungsleitungen (Stromversorgung, Biasspannung, Messleitungen, Kühlmedium) in die Behandlungskammer durchgeführt werden. Für elektrische Anschlüsse kann dies beispielsweise durch Schleif-, Gleit-, Feder oder Steckkontakte erfolgen.

[0013] Gemäss einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist die Vakuumanlage ein Gas schnellkühl-/heizsystem für die Behandlungskammer mit dem Werkstückträger und den Werkstücken auf, die es erlaubt, ein Gas über ein Gaseinlasssystem in die Behandlungskammer einströmen zu lassen und aktiv in der Anlage umzuwälzen. Zur Gasumwälzung können bevorzugt Teile der Vorpakum-Erzeugungsvorrichtung mitgenutzt werden. Der Kühl-/Heizeffekt auf die Werkstücke wird bevorzugt und konstruktiv einfach erreicht, wenn im Umwälzsystem ein Gaswärmetauscher angebracht wird, der dem Gas Wärme entzieht oder zuführt. Die Rückkühlung des Wärmetauschers kann in bekannter Weise gegen Wasser oder Luft erfolgen, die Beheizung beispielsweise elektrisch. Als Gas kommen Helium,

45

50

55

Stickstoff, Formiergas (Stickstoff mit wenigen Prozent Wasserstoff) oder andere im Stand der Technik bekannte Gase in Betracht. Eine Druckregeleinrichtung sorgt für einen Druckbereich zwischen im wesentlichen 100 mbar bis Atmosphärendruck, bevorzugt werden 800 mbar.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können am Werkstückhalter, der Aufnahmeverrichtung oder an anderen geeigneten Teilen der Anlage mechanische oder elektromechanische Vorrichtungen vorgesehen werden, die es erlauben, eine definierte Be- und Entladeposition für Werkstückhalter und Aufnahmeverrichtung festzulegen oder einzuhalten. Die Einstellung einer solchen Position kann motorisch, vorteilhafterweise gesteuert, erfolgen. Geeignet sind hierfür beispielsweise Endschalter, induktive Näherungsschalter, mechanischer Anschlag oder gattungsverwandte Einrichtungen.

[0015] Die elektrischen Verbindungen für beispielsweise Substratbias oder Messleitungen können gemäss einer weiteren Ausführungsform über Kontakte erfolgen, die korrespondierend in Aufnahmeverrichtung und Werkstückhalter vorsehbar sind. Diese können bevorzugt als Schleif-, Gleit-, Feder- oder Steckkontakte erfolgen. Je nach Ausführung der Führungs- und Verbindungseinrichtungen lassen sich so die medienschlüssigen Verbindungen als Punkt- zu Punktkontakt oder als Punkt- zu achsensymmetrischem ringförmigem Flächenkontakt oder weiteren bekannten Ausführungsformen realisieren.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform besteht darin, die Anode als Bestandteil der Aufnahmeverrichtung, elektrisch davon isoliert, vorzusehen. Besonders einfach gestaltet sich eine zentral auf der Drehachse der Aufnahmeverrichtung angebrachte Anode. Ohne Funktionalitätseinbusse kann diese mitrotierend mit der Aufnahmeverrichtung ausgeführt werden. Je nach Ausführungsform kann die Anode unterhalb oder oberhalb der Aufnahmeverrichtung für den Werkstückträger angeordnet werden. In der oberhalb angebrachten Position kann die Anode in der Ebene der Aufnahmeverrichtung horizontal teilbar ausgeführt werden, so dass der obere lösbare Teil als Anodenkopf abnehmbar ist. Daraus ergeben sich Vorteile bei der Wartung und Anlagenreinigung.

[0017] Das zur Kühlung der Anode benötigte Medium, bevorzugt Kühlwasser, kann über ein im wesentlichen achsenparalleles Rohr in die im unteren Teil vorteilhafterweise als Hohlzylinder ausgebildete Anode eingespeist, durch entsprechende mechanische Einbauten im Kopf der Anode verteilt und anschliessend durch den Anoden-Hohlzylinder oder ein zweites im wesentlichen achsenparallelen Rohr abgeleitet werden. Die Zu- bzw. Ableitung erfolgt dabei vorteilhafterweise mit drehbeweglichen am unteren atmosphärenseitigen Ende der Anode befestigten Kopplungselementen.

Zusätzlich kann, je nachdem ob die gesamte Anode beim Ladevorgang in der Anlage verbleibt oder zumin-

dest der Anodenkopf mit dem Werkstückträger aus der Anlage entnommen wird, eine zusätzliche, durch das Aufsetzen bzw. Abheben des Werkstückträgers automatisch betätigte Kopplung der Zu- bzw. Ableitung des Kühlmediums vorgesehen werden.

[0018] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführung kann die Behandlungskammer der Vakuumanlage mit Magnetspulen nach Art eines Helmholtz-Spulenpaars zur Plasmabeeinflussung umgeben werden. Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn mindestens eine der Spulen, bevorzugt die untere, im Durchmesser kleiner, am Anlagenboden aussen und konzentrisch um die Hohlachse der Antriebseinrichtung angelegt wird. Dies ermöglicht, die seitliche Be- und Entladeöffnung flexibler am Rezipienten anzuordnen. Überraschenderweise wird die Plasmabeeinflussungsmöglichkeit durch diese geänderte Dimensionierung kaum gestört. Eine weitere Ausführungsform ermöglicht es, die im Durchmesser kleiner dimensionierte Spule mit mehr Windungen auszuführen und so einen weitere Möglichkeit zur Magnetfeldanpassung zu gewinnen. Auch wäre eine separate Strom/Spannungsversorgung für die untere Spule mit individueller Regelung möglich.

[0019] Die Erfindung wird nun anhand schematischer Figuren beispielsweise beschrieben.

[0020] Figur 1 zeigt eine aus dem Stand der Technik vorbekannte Vakuumanlage mit zentraler Niedervoltbogen-Entladungsanordnung.

[0021] Figur 2 zeigt eine dem Stand der Technik entsprechende Vakuumanlage mit asymmetrischer Niedervoltbogen-Entladungsanordnung.

[0022] Figur 3 erläutert eine erfindungsgemäss Ausführung einer Vakuumanlage.

[0023] Figur 4 ist ein Detail der Anordnung der Kopplungseinrichtung mit unterer Anodenanordnung,

[0024] Figur 5 mit oberer Anodenanordnung.

[0025] Figur 6 fasst die wesentlichen Merkmale einer bevorzugten Ausführungsform der Kopplungseinrichtung zusammen.

[0026] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung Anlage für den grossindustriellen Einsatz nach dem Stand der Technik. In der zentralen Achse 19 des Rezipienten 1a sind Ionisationskammer 4 und Anode 5 angeordnet. Letztere kann entweder von unten durch den

Anlagenboden wie in 5a oder von oben wie in 5a' dargestellt in die Anlage eingeführt werden. Zur Stabilisierung des Niedervoltbogens sind weiters eine obere 6a und eine untere Spule 7a an der Anlage angebracht. Die drehbeweglich gelagerten Werkstückhalter 2 sind entweder direkt auf dem als Ladeöffnung 3a ausgebildeten Anlagenboden oder auf einem ebenfalls auf der Ladeöffnung 3a montiertem hier nicht dargestellten ebenfalls drehbeweglich ausgeführten Werkstückträger befestigt.

Dadurch kann der durch die Bewegungspfeile 20 symbolisierte Be- und Entladevorgang nur durch ein Verschieben der Ladeöffnung 3a nach unten durchgeführt werden. Die daraus resultierenden Nachteile sind eine hohe Anlagenbauhöhe und ein entsprechender Raum-

bedarf sowie ein umständlicher, zeitaufwendiger Be- und Entladevorgang. Dasselbe gilt für eine hier nicht dargestellten Variante, bei der der Rezipient für den Be- und Entladevorgang nach oben abgehoben wird. Als weiterer Nachteil ergibt sich für beide Varianten die Notwendigkeit alle Versorgungsleitungen für den als Ladeöffnung 3a ausgebildeten Anlageboden bzw. Rezipienten 1a (Kühlwasser und Elektrik) in aufwendiger beweglicher Ausführung vorzusehen.

[0027] Figur 2 zeigt eine Vakuumanlage mit Niedervoltbogen-Entladungsanordnung mit einfacher Front-Be- und Entladeöffnung 3b. Die mindestens eine Niedervoltbogen-Entladungsanordnung bestehend aus einer Ionisationskammer 4 und Anode 5b ist dazu seitlich an den Rezipienten 16, parallel zu beweglich auf einem Werkstückträger 10 angebrachten Werkstückhaltern 2, angebracht.

[0028] Figur 3 Fig. 3. zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Valumbehandlungsanlage mit einem Rezipienten 1c, in der zentralen Achse 19 angeordnete Niedervoltbogen-Entladungsvorrichtung bestehend aus Ionisationskammer 4 und Anode 5c, oberer 6c und unterer Spule 7c, Verdampferquelle(n) 21, Werkstückträger 10c, Werkstückhalter 2, sowie einer von vorne zugänglichen Ladeöffnung 3c. Weitere bekannte Anlagenkomponenten wie Vakuumpumstand, Gaszufuhr, Messröhren, Regel- und Steuerungseinrichtungen sowie Bedienelemente werden hier nicht weiter dargestellt.

[0029] Um trotz des drehbeweglich gelagerten Werkstückträgers eine aufwendige und dennoch leicht trennbare Medienversorgung mit vakuumdichten Übergang in den Rezipienten sicherzustellen (Substratspannung sowie bei Bedarf verschiedene Messspannungen an den Werkstückträger, Anodenspannung und Kühlwasser an bzw. in die Anode), wurden verschiedene erfinderische Lösungen vorgesehen, die in den folgenden Figuren beschrieben werden. Allen Ausführungen gemeinsam ist, dass der Werkstückträger 10 in einfacher Weise durch Anheben mit einer bekannten hier nicht näher dargestellten Hebevorrichtung, wie beispielsweise einem Gabelstapler, von den auf einer mit Lagern 23 versehenen Grundplatte 24 abgehoben und mit den darauf befestigten Werkstückhaltern 2 sowie beschichteten Werkstücken aus der Anlage entladen werden kann. Dabei genügt es, die Unterkante des Werkstückträgers mit genügenden Spiel über die Oberkante der Anode 5 zu haben. Insgesamt sind dafür nur wenige Zentimeter bis maximal etwa einen Dezimeter Hub aus der angekoppelten Beschichtungsposition notwendig.

[0030] Die in FIG. 4 gezeigte erfinderische Ausführung zeigt ein mechanisch einfach zu verwirklichendes Konzept. Dabei ist die Anode 5d unterhalb der Grundplatte 24d bzw. unterhalb des Werkstückträgers 10d angebracht, wodurch die Kühlwasserleitung 18 und Anodenstromzuführung 17d exzentrisch erfolgen kann. Dies hat den Vorteil, dass in der Hohlwelle 11d mehr Platz für die anderen Medienleitungen verbleibt. Wichtig ist bei dieser Ausführung, Grundplatte 24d und / oder

Werkstückträger 10d so zu bauen, dass der Niedervolt-Bogen möglichst ungestört von der hier nicht dargestellten Ionisationskammer auf die Anode 5d brennen kann. Dies ist beispielsweise durch Vorsehen von Speichen

5 an Grundplatte 24d und / oder Werkstückträger 10d möglich. Um einen zu starken Ätzabtrag derartiger dem NV-Bogen ausgesetzten Einbauten zu verhindern, werden diese vorteilhafterweise mit vom Biaspotential isolierten auf Massepotential gelegten Blechen geschützt.

[0031] Bei den in FIG. 5 und 6 dargestellten Varianten wird die Anode 5 im wesentlichen parallel in oder etwas überhalb der Grundfläche des Werkstückträgers 10 angebracht, sodass zwischen Anode 5 und Ionisationskammer 4 eine freie optische Sichtverbindung besteht. Dadurch kann bei Beachtung der für Plasmaprozesse üblichen Dunkelraumabstände zwischen Einbauten unterschiedlichen Potentials ein stabiles NV-Plasma gezündet und aufrechterhalten werden, ohne dass sich störende Nebenplasmas ausbilden.

[0032] In FIG. 5 erfolgt die Anodenstromzuführung 17e über einen im Vakuum laufenden Schleifkontakt 25e, diese Ausführung ist vorteilhaft, wenn keine zusätzlichen Messleitungen für den Werkstückträger benötigt werden.

[0033] Eine besonders vorteilhafte Ausführung der Erfindung zeigt Fig. 6. Dabei erfolgt die Substratbias-16 und die Anodenstromzuführung 17f atmosphärenseitig bevorzugt mittels Schleifkontakte 25g an die Hohlwelle 11f bzw. Anode 5f. Der Abgriff der mindestens einen in der Hohlwelle 11f geführten und mitbewegten Messelementzuleitung 8f,g erfolgt atmosphärenseitig über eine je nach Bedarf vorzusehende Anzahl von Gleitkontakten (nicht dargestellt). Die Signalübertragung von der Grundplatte 24f auf den Werkstückträger erfolgt über mindestens einen Steckkontakt wobei die Feinpositionierung vorzugsweise über ein mit beispielsweise ineinanderlaufende Kegeflächen zentriertes Lager 23f erfolgt.

[0034] Durch die erfindungsgemäße, durch einfaches Anheben lösbare Ankopplung des Werkstückträgers an die Grundplatte der Aufnahmeverrichtung ist es erstmals möglich an einer mit einer zentral angeordneten Niedervoltbogen-Entladungsvorrichtung versehenen PVD-Beschichtungsanlage (physical vapour deposition) eine Frontladeöffnung anzubringen. Dadurch ergibt sich im Vergleich zu anderen Anlagen mit gleichem oder ähnlichem Volumen der Anlagenkammer eine deutlich niedrigere Bauhöhe. Die damit gegebene Möglichkeit eines sehr raschen Be- und Entladevorgangs wirkt sich besonders vorteilhaft auf die Produktivität einer solchen Anlage aus. Werden beispielsweise zwei oder mehrere Werkstückträger verwendet, so kann ein Werkstückträger mit beschichteten Werkstücken gegen einen Werkstückträger mit unbeschichteten Werkstücken rasch ausgetauscht werden. Das Bestücken der Werkstückhalter kann somit während des Beschichtungsprozesses erfolgen.

[0035] Ein weiterer wesentlicher Vorteil der zentralen

Anordnung der Niedervoltbogen-Entladungsvorrichtung ergibt sich dadurch, dass bei Bedarf auch während des Beschichtungsprozesses, insbesondere beim Übergang vom Ätz- auf den Beschichtungsvorgang eine zusätzliche Ionisierung erzielt werden kann. Dies hat sich bei insbesondere mit Reaktivgas durchgeführten Sputterprozessen häufig als vorteilhaft erwiesen. Beispielsweise ist es damit auch möglich definierte nanolaminaren Strukturen mit unterschiedlicher Schichtzusammensetzung abzuscheiden.

[0036] Mit vorliegender flexibler PVD-Anlage ist es erstmals möglich auch bei Arcbeschichtungen derartige Beschichtungsprozesse bzw. fliessende Übergänge zwischen Niedervoltbogen-Ätzen und Beschichtungsvorgang durchzuführen. Weiters kann bei Bedarf durch eine solcherart angeordnete Niedervoltbogen-Entladungsvorrichtung das Erwärmen der Werkstücke auf Prozesstemperatur durchgeführt werden.

[0037] Mit der erfundungsgemässen PVD-Anlage ist es erstmals möglich ohne Prozessunterbruch Sputter- und Arcbeschichtungsprozesse entweder getrennt, hintereinander oder auch gemischt zu fahren und gleichzeitig eine Plasmavorbehandlung bzw. Plasmaunterstützung durch ein zentrales Niedervoltbogenplasma vorzusehen.

Patentansprüche

1. Vakuumanlage zum Behandeln von Werkstücken, mit einer evakuierbaren Behandlungskammer (1), in deren Zentralachse (19) eine Niedervoltbogen-Entladungsanordnung angeordnet ist, und mindestens einer an einer Seitenwand der Behandlungskammer angebrachten Beschichtungsquelle (21) sowie einem Werkstückträger (10), auf dem Werkstücke gegebenenfalls auf zusätzlichen Werkstückhaltern (2) montiert sind, **dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstückträger (10) durch eine kraft- und medienschlüssige Kopplungseinrichtung lösbar mit einer Aufnahmeverrichtung im Boden der Behandlungskammer verbunden ist und die Beschichtungskammer eine seitlich, bevorzugt auf der Vorderseite, angebrachte verschliessbare Öffnung aufweist, deren Querschnitt grösser als der des Werkstückträgers (10) ist, so dass der Werkstückträger gemeinsam mit den gegebenenfalls auf zusätzlichen Werkstückhaltern (2) montierten Werkstücken entkoppelt und aus der Vakuumanlage entfernt werden kann.**
2. Vakuumanlage nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass die Kopplungseinrichtung unter anderem aus kraftschlüssigen Führungs- und Verbindungseinrichtungen an Werkstückträger und Aufnahmeverrichtung besteht, vorzugsweise am Werkstückträger (10) ausgebildet als Führungsstifte, besonders vorteilhaft als selbstzentrierende**
- 5 3. Vakuumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Werkstückträger um die Zentralachse (19) der Behandlungskammer (1) rotierbar angeordnet ist.
- 10 4. Vakuumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Aufnahmeverrichtung für den Werkstückträger (10) in der Zentralachse (19) der Behandlungskammer (1) drehbar angeordnet ist.
- 15 5. Vakuumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die drehbare Aufnahmeverrichtung im wesentlichen als lotrechte Hohlachse (11) mit einem motorischen Antrieb ausserhalb der evakuierbaren Behandlungskammer ausgeführt ist sowie Vorrichtungen zur Durchführung von Medien, bevorzugt Anodenstromversorgung (17), Substratbias (16), Kühlmedium (18) und Messleitungen(8), aufweist.
- 20 6. Vakuumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** Mittel zur Festlegung der Be- und Entladeposition des Werkstückhalters in der Behandlungskammer vorgesehen sind, bevorzugt Endschalter, induktive Näherungsschalter, mechanischer Anschlag oder gatungsverwandte mechanische oder elektromechanische Vorrichtungen.
- 25 7. Vakuumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die elektrischen Verbindungseinrichtungen der lösabaren Kopplung aus Schleif- (25), Gleit- (26), Feder- oder Steckkontakte bestehen.
- 30 8. Vakuumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vakuumanlage ein Gasschnellkühl-/heizsystem für die Behandlungskammer mit den Werkstückträger und den Werkstücken aufweist mit einem Gaseinlasssystem, einer Gasumwälzvorrichtung und einem Gaswärmetauscher.
- 35 9. Vakuumanlage nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gasschnellkühl-/heizsystem mit einer Druckregeleinrichtung versehen ist für einen Druckbereich zwischen im wesentlichen 100 mbar bis Atmosphärendruck, bevorzugt bei 800
- 40
- 45
- 50
- 55

mbar und dass als Gas Helium, Stickstoff oder Formegas eingesetzt wird.

10. Vakumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass die Anode der Niedervoltbogen-Entladungsanordnung zentrisch an der drehbaren Aufnahmeverrichtung angebracht ist.** 5
11. Vakumanlage nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (5) in der Ebene der Aufnahmeverrichtung horizontal teilbar ist und der obere lösbare Teil als Anodenkopf abnehmbar ist.** 10
12. Vakumanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass zur Plasmabeeinflussung an der Behandlungskammer Magnetfelderzeuger wie Permanentmagnete, bevorzugt Magnetspulen (6, 7) angebracht sind, vorzugsweise nach Art von Helmholtz-Spulen.** 15
13. Vakumanlage nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass eine der Spulen (7c) des Helmholtz-Spulenpaars einen kleineren Durchmesser aufweist als die andere (6c) und unterhalb der Behandlungskammer, zentrisch um die Zentralachse der Behandlungskammer orientiert, angeordnet ist.** 20
14. Vakumanlage nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass die Spulen sich in ihrer Windungszahl unterscheiden, bevorzugt die im Durchmesser kleinere eine höhere Windungszahl aufweist.** 25

30

35

40

45

50

55

Fig.1

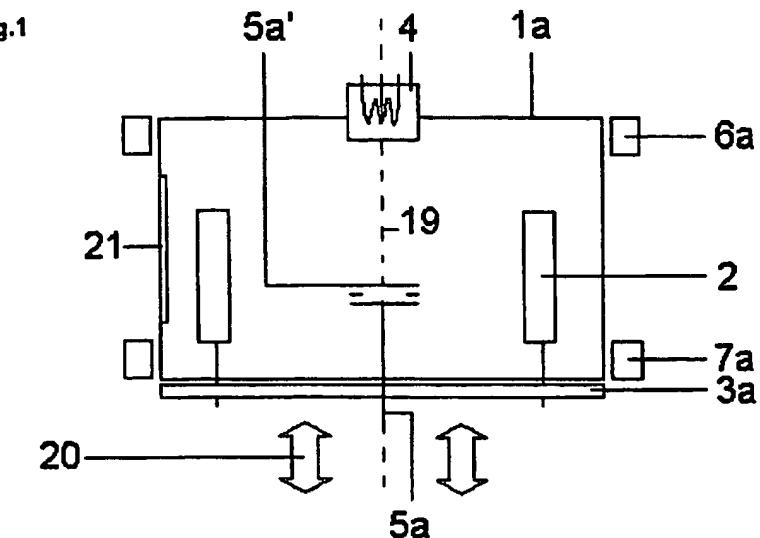


Fig.2

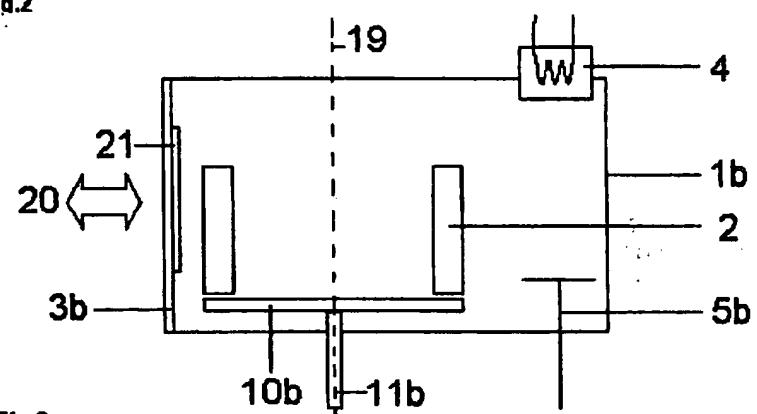


Fig.3

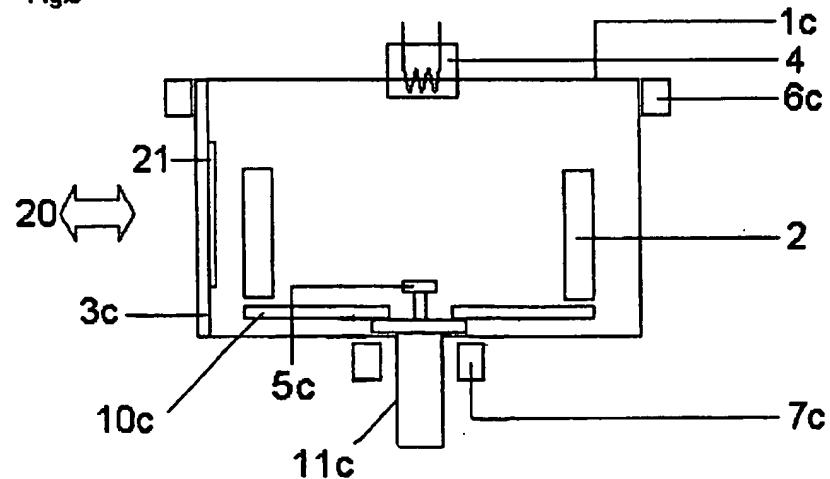


Fig.4

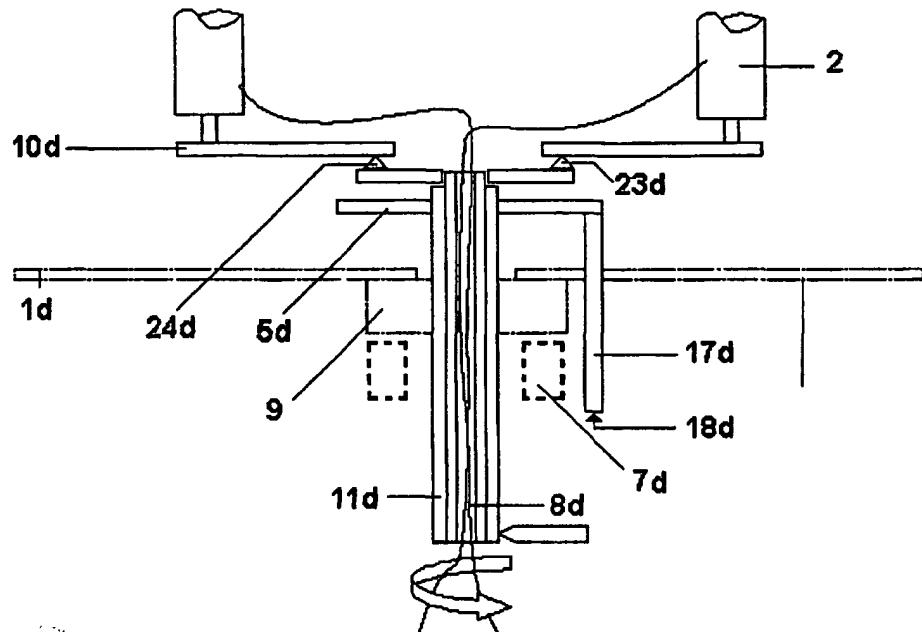


Fig.5

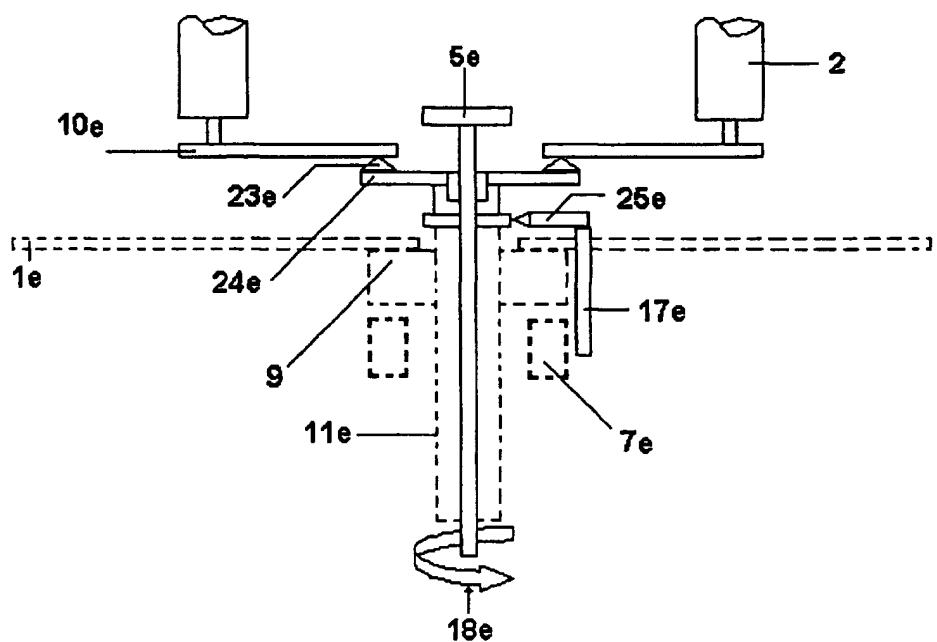
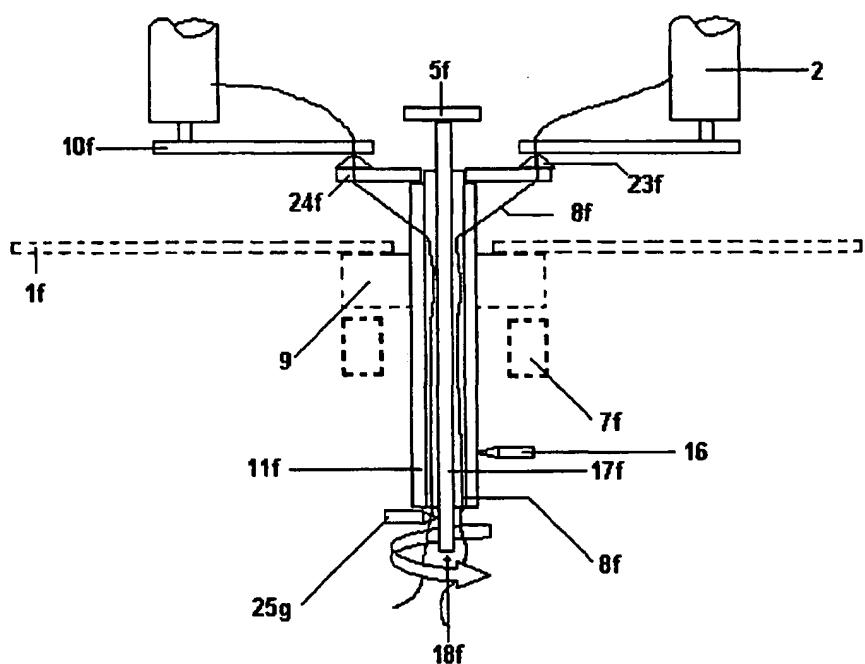


Fig.6





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 11 9423

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.)		
A	EP 0 885 981 A (EBERHARD MOLL GMBH DR) 23. Dezember 1998 (1998-12-23) * Spalte 8, Zeile 45 - Spalte 9, Zeile 42; Abbildungen 1,2 *	1-14	C23C14/32 H01J37/32 C23C14/50 C23C14/34		
A	US 4 877 505 A (BERGMANN ERICH) 31. Oktober 1989 (1989-10-31) * Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 7, Zeile 40 *	1-14			
A	EP 0 668 369 A (HAUZER HOLDING) 23. August 1995 (1995-08-23) * Abbildung 3 *	1-14			
<table border="1"> <tr> <td>RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.)</td> </tr> <tr> <td>C23C H01J</td> </tr> </table>				RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.)	C23C H01J
RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.)					
C23C H01J					
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt</p>					
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer			
DEN HAAG	11. Dezember 2001	Ekhult, H			
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE					
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund C : technische Offenbarung P : Zwischenliteratur					
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie. Übereinstimmendes Dokument					

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 11 9423

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterreichung und erfolgen ohne Gewähr.

11-12-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0885981	A	23-12-1998	DE EP JP US	19725930 A1 0885981 A2 11124668 A 6045667 A	24-12-1998 23-12-1998 11-05-1999 04-04-2000
US 4877505	A	31-10-1989	AT DE EP ES JP	65265 T 3863725 D1 0306612 A1 2022946 T5 1083656 A	15-08-1991 22-08-1991 15-03-1989 16-12-1991 29-03-1989
EP 0668369	A	23-08-1995	DE AT DE DK EP ES	4405477 A1 186335 T 59507150 D1 668369 T3 0668369 A1 2140569 T3	24-08-1995 15-11-1999 09-12-1999 07-02-2000 23-08-1995 01-03-2000

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

Vacuum system with separable work piece support

Patent Number: [US2002053322](#)

Publication date: 2002-05-09

Inventor(s): DERFLINGER VOLKER (AT); SEELI ROGER (CH); PEDRAZZINI MAURO (LI)

Applicant(s):

Requested Patent: [EP1186681](#)

Application Number: US20010947454 20010905

Priority Number(s): CH20000001727 20000905

IPC Classification: C23C16/00

EC Classification: C23C14/32A; C23C14/34G2; C23C14/50B; H01J37/32G

Equivalents: JP2002105629

Abstract

A vacuum system for the treatment of work pieces has an evacuable treatment chamber having a centrally disposed low voltage arc discharge arrangement and laterally disposed loading opening. A coupling device between the work piece support and a receiving device on the system side allows simplified loading and removal of the work pieces to be treated along with the support by simply lifting onto or lowering from the receiving device

Data supplied from the esp@cenet database - I2